

Einladung an

alle Mitglieder des CFN
und alle Interessierten des KIT



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Erstes NSL-Nutzertreffen mit Einweihung des neuen ICP-Plasmaätzers

Am **Dienstag**, den **19. Juli 2011**, im **Otto-Lehmann-Hörsaal** (Geb. 30.22), Engesserstr. 7, EG

Programm

14:00 G. Goll Annual training in the use of the cleanroom
(mandatory for all users of NSL cleanroom)

Presentation of selected NSL devices and user reports

14:45 E. Müller **Focussed-Ion-Beam Applications**

15:15 I. Staude Functional Elements in Three-Dimensional Photonic Bandgap Materials (user report)

15:30 A. Böttcher Towards Imprinting of Nanographene Arrays (user report)

15:45 S. Kühn **Laser Lithography**

16:15 C. Reiche Using the DWL66 Laser Lithography System to Contact Single Bismuth Nanowires
(user report)

16:30 B. Richter Two-component Polymer Scaffolds for Controlled 3D Cell Culture (user report)

16:45 coffee break

17:15 G. Goll **Dry Etching by RIE and ICP Processes**

17:45 J. Gramich Fabrication of Nanostructured Superconductor-Ferromagnet Point Contacts (user
report)

18:00 M. Helfrich Substrate Patterning for Site-Selective Quantum Dot Growth (user report)

Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, bei einem gemütlichen Beisammensein am Teich vor dem Physikhochhaus zu grillen. Grillgut bitte selbst mitbringen, Getränke werden auf Selbstkostenbasis be-
sorgt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gernot Goll

- Leiter Nanostruktur-ServiceLabor (NSL) -